

日光協 ニュース

No.296/297

2025年4月/5月

日本光学工業協会

本年4月、5月の合併号としてお届け致します。

令和7年度 ISO/TC 172/SC1 分科会

令和7年5月21日(水)、機械振興会館にて、ISO/TC 172/SC1分科会が行われました。議題は次の通り。

- ① SC1分科会規約改正案
- ② 令和6年度SC1分科会活動報告
- ③ 令和6年度収支報告、監査報告
- ④ その他

以下は、金山谷SC1分科会長の報告書からの抜粋です。

1. 構成

議長：Dr. Richard Youngworth (米国: Riyo LLC)

事務局 (Committee Manger) : Clara Engesser (ドイツ DIN)

メンバー(2024/9 現在) :

Participating countries (12)	Observing countries (12)
ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ルーマニア、ロシア、スイス、英国、米国	オーストリア、ブルガリア、チェコ、イラン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、セルビア、スロバキア、スペイン、ナイジェリア

WG :

		Convenor	国内主査
WG1	General optical test methods	Eckhard Langenbach (スイス、FISBA)	平井真一郎 (キヤノン)
WG2	Preparation of drawings for optical elements and systems	Richard N. Youngworth (米国: Riyo LLC)	上田稔 (オリンパスメデイカルシステムズ)
WG3	Environmental test methods	Michel Honlet (ドイツ、Cassidian社)	村田寛信 (ニコン)

WG4	Data transfer	休眠状態	上窪淳二 (HOYA)
Ad hoc Croup2	SC1 standards related to photography	David Aikens (米国, Savvy Optics)	上窪淳二 (HOYA)

2. 活動状況

2.1 国際会議

2.1.1 概要

今回 10/08 にそれぞれ WG1、WG2 が同時間に別々で会議開催となった。10/09 は WG1+WG2 の合同会議、SC1 WG1+ SC3 WG1 のジョイントミーティング、10/10 は SC1 Plenary Meeting が行われた。ここでは Plenary Meeting を中心に報告する。P メンバーは、SC1 議長の米国、を含めて 13 カ国（ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ナイジェリア、ルーマニア、ロシア、スイス、英国、米国）だが、今回の Plenary meeting への参加は計 3 カ国に留まった。

会議では、行動規範の確認後 Secretary report として ISO/TC 172/SC1 の現状、この一年の活動内容、ISO 指令更新内容等が SC1 の committee manager の Clara Engesser から報告された。

2.1.2 SC1 Plenary Meeting 内容

1) 出席メンバー

日本からの出席者（敬称略）は、上田（日本光学工業協会）、平井（キヤノン）、上田（オリンパスメディカルシステムズ）、金山谷（ニコン）

2) 討議および決定内容

各 WG での議論について（抜粋）

① 現状の SC1 の構成

1. Committee Manager: Clara Engesser (ドイツ)

2. Chair (until 2024): Richard Youngworth (米国)

①WG1 (General optical test methods) Convener: Daniel Kiefhaber (ドイツ、2026/末まで)

②WG2 (Preparation of drawings for optical elements and systems) Convener: Richard Youngworth (米国、2025/末まで)

③WG3 (Environmental test methods) Convener: Michel Honlet (ドイツ、2026/末まで)

3. 参加国

- ・ Participating countries (12)：前回からナイジェリアが O メンバーに変更
ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ルーマニア、ロシア、スイス、英国、米国
- ・ Observing countries (13)：前回から 2 カ国増加（ニュージーランド、ナイジェリア）
オーストリア、ブルガリア、チェコ、イラン、ニュージーランド、ナイジェリア、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、セルビア、スロバキア、スペイン

4. リエゾン (SC1 側)

- ・ TC10/SC1 (Basic conventions): Clara Engesser (ドイツ)
- ・ TC10/SC6 (Mechanical engineering documentation): Clara Engesser (ドイツ) Mr Strobehn
- ・ TC 42 (Photography): Clara Engesser (ドイツ)、Mr Herman
- ・ TC184/SC4 (Industrial data): Clara Engesser (ドイツ)
- ・ TC213 (Dimensional and geometrical product specifications and verification): Clara Engesser (ドイツ), Paul E. Murphy (米国)

② 新規発行された ISO (2023/9-2024/10)

ISO 10109

“Optics and photonics — Guidance for the selection of environmental tests”
(WG3; Eric Herman)

③ 現行中のプロジェクト

1. ISO/PWI 9358
2. ISO/CD 11421.2
3. ISO/CD 14999-4
4. ISO/CD 10110-5
5. ISO/DIS 9335
6. ISO/DIS 10110-11
7. ISO/DIS 10110-6

④ 2025 年の Systematic review

1. ISO 15529:2010 WG1
2. ISO 10110-19:2015 WG2

⑤ 2025 年の Systematic review WG3 9 件

ISO9022-2:2015 / ISO 9022-6:2015 / ISO 9022-7:2015 / ISO 9022-8:2015 /
ISO 9022-11: 2015 / 9022-12: 2015 /9022-14: 2015 /9022-17: 2015 /9022-11:
2015

⑥ その他

2025/1 月から新しい Web Tool に移管

詳細は Web 参照方： <https://sway.cloud.microsoft/s4WjFoQKazarZFpF>

3) Plenary 報告

i. 決議同日インドが欠席、Committee Manger からきちんと連絡が行っていなかった反省から始まり、例年通り、SC 1 の活動報告から行われた。特記事項としては 2025 年 1 月から Web ツールが変更になりより使いやすいものになるとのこと。

ii. 各決議に関して

- ① 基本各 WG で決めた Recommendation について報告のため、承認形式で進められた。US や日本は WG で反対意見を表明していた一部案件も Committee Manger の配慮により各国の想いを Resolution のコメントに反映されたが決議は Recommendation を尊重し決議となった。
- ② 次回国際会議について： SC1 JISC からは 2 年間の準備が必要とのコメントを出していた。そのためオブザーバー参加の SC3 に 2026 年にするか 2027 年にするかを要望し、回答出ず SC3 が持ち帰り。2025 年 1 月に 2026 年日本開催を決定した。

4) その他

国際会議開始前に Chair から「コミュニケーションが難しいだろうから日本には確認で合図を送る」旨を打診され、了承し会議が始まった。また事前に話したいことを相談しておくで会議では配慮もしてくれる状況だった。今回 ISO14999-4 10110-5 に関しては事前準備で報告資料を作成し各国に送って協議ができていればもう少し良い方向に話せたかと思う。可能であれば CD の投票の時にテクニカルコメントの場合、説明資料を用意できると各国の理解が深まると感じた。

2.2 国内会議

- ・2024年7月3日：SC1/WG3 Web 会議：主査交代、2023年度活動報告他（WG3）
- ・2024年7月18日：SC1 国際会議@ボルダーに向けた議論（WG1+WG2）
- ・2024年8月6日：SC1 国際会議@ボルダー準備状況確認（WG1+WG2）（Web）
- ・2024年9月12日：ISO/CD10110-5 に関する確認（Web）
- ・2024年10月1日：SC1 国際会議@ボルダー準備状況確認（WG1+WG2）（Web）
- ・2024年12月17日：国際会議@ボルダーの審議内容報告（WG1+WG2）
- ・2025年1月29日：ISO/CD10110-5 と ISO/CD14999-4 の確認（WG1+WG2）
- ・2025年1月31日：ISO/CD10110-5 と ISO/CD14999-4 の確認（WG1+WG2）（Web）
- ・2025年2月19日：2/10 の国際会議の審議内容報告（Web）

2.3 JIS 改訂

ISO 10110-2, -3, -4 廃止、ISO 10110-18 に統合に伴い、JIS B0090-2, -3, -4 を廃止し、JIS B0090-18 を新規に制定する方針を決め、改訂作業に着手。

2.4 規格案投票

下記規格番号に対する投票を遅延なく行った。

規格案投票関係（2024/4-2025/3）

種類	規格番号	名称	投票	締切日
SR	ISO 9022-4:2014 (Ed 3, vers 2)	光学とフォトンクス — 環境試験方法: Salt mist	Confirm	2024/6/3
DIS	ISO/DIS 9335 (Ed 3)	OTF 測定原理と手順	Approved	2024/8/12
FDIS	ISO/FDIS 9335 (Ed 3)	OTF 測定原理と手順	Approved	2025/1/21
SR	ISO 9358:1994 (vers 6)	光学および光学機器—画像形成システムのベールグレア—定義と測定方法	Confirm	2024/9/2
SR	ISO 10110-1:2019 (Ed 3)	光学素子及び光学システム用の製図手法：通則	Revise	2024/6/3
DIS	ISO/DIS 10110-6	光学素子及び光学システム用の製図手法：偏心公差	Approved	2024/4/4
SR	ISO 10110-8:2019 (Ed 3)	光学素子及び光学システム用の製図手法：表面性状（粗さ及びうねり）	Confirm	2024/6/3
DIS	ISO/DIS 10110-11 (Ed 3)	光学素子及び光学システム用の製図手法：公差表示のないデータ	Approved	2024/4/18

FDIS	ISO/FDIS 10110-11 (Ed 3)	光学素子及び光学システム用の製図手法：公差表示のないデータ	Approved	2025/2/25
SR	ISO 10110-12:2019 (Ed 3)	光学素子及び光学システム用の製図手法：非球面	Confirm	2024/6/3
DIS	ISO/DIS 11421 (Ed 2)	光学および光学機器—OTF 測定の精度	Approved	2025/3/19
SR	ISO 13653:2019 (Ed 2)	光学およびフォトニクス — 一般的な光学試験方法 — 画像フィールドの相対放射照度の測定	Confirm	2024/9/2
SR	ISO 19962:2019	光学とフォトニクス — 平行平面光学素子による積分散乱の分光測定法	Revise	2024/9/2
CIB	Draft Resolution 01/2024 for correspondence		Approved	2024/9/10
CIB	Draft Resolution 5/2024 for vote		Approved	2024/11/9
CD	ISO/CD 10110-5	光学素子及び光学システム用の製図手法：表面形状公差	CD に対するコメント投票	2024/8/28
CD	ISO/CD 11421.2	光学および光学機器—OTF 測定の精度	CD に対するコメント投票	2024/5/16
CD	ISO/CD 14999-4	光学素子及び光学システムの干渉測定 — 表面形状及び波面形状公差の用語及び定義	CD に対するコメント投票	2024/8/28
CIB	Resolution 30/2024 for vote - ISO/PWI 10110-1		Approved	2025/1/14

3. その他

(1) 2024 年度は WG3 の主査が引き継がれ徳田憲昭氏（ニコン）から村田寛信（ニコン）に引き継がれた。徳田氏のこれまでの JISC での貢献に感謝するとともに村田氏の今後の WG 運営での活躍に期待する。

(2) 2024 年国際会議では ISO 14999-4(WG1), ISO10110-5(WG2)の CD が特に難航したが良い議論ができていると感じる。ひとえに国内でエキスパートとして参加していただいているメンバー、継続的にかつ積極的に審査に携わっていただいている各主査によるものであり、これに対し SC1 国内分科会長として感謝する次第である。

以上

令和 7 年度後期 光学機器製造（光学機器組立て作業）中央技能検定委員会

令和 7 年 5 月 9 日(金)、ハイブリッド（対面 & Web）形式にて、第一回中央技能検定委員会が開催され、令和 6 年度実施結果報告と都道府県アンケートの協議、令和 7 年度学科試験問題と実技試験問題等の審議が行われました。当協会推薦の光学各社の中央技能検定委員とともに、当協会からは事務局長が参加いたしました。

企業等における公正な採用選考の実現に向けて(要請)

職発 0328 第 10 号 令和 7 年 3 月 28 日

厚生労働省職業安定局長より、当協会会長宛に要請を受領しました。以下に抜粋を記します。

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。厚生労働行政の運営につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、厚生労働省では、応募者の基本的人権を尊重し、広く応募者に門戸を開くとともに、適性・能力に基づいた採用選考を行う公正な採用選考システムの確立が図られるよう周知・啓発を行っています。

近年、情報化の進展に伴いインターネット上に差別的な書き込みが行われるなどの状況変化が生じていることを踏まえ、平成 28 年 12 月に成立した「部落差別の解消の推進に関する法律」の着実な施行により、国として部落差別を解消するための教育啓発等の取組みを進めているところです。

公正な採用選考システムの確立に向けては、企業に対する周知・啓発に取り組んでいますが、その一方、採用担当者のみならず企業トップクラスにおいても、面接や応募用紙等で「本籍出生地」や「家族」に関することを把握するなど、就職差別につながるおそれのある不適切な事象も依然として発生している現状にあります。

近年、我が国を含め世界が大きな変化に直面する中で、いかに新しい時代に対して柔軟な対応ができるかが大きな課題となっています。つまり、社会の変化を取り入れ、多様化した価値観を尊重することができるかが求められているということです。

この変化は企業に対しても例外ではなく、企業が多様性を受け入れ、多様な人材を活躍させることができるかが注目される時代になっています。そのような中、仮に、採用選考の場面で応募者の人権を軽視するような言動が明らかになれば、人材確保に支障を来すばかりか、社会的な批判からステークホルダーの信頼を損ない、企業価値を低下させることにもつながりかねません。

貴団体におかれましては、こうした公正採用選考の趣旨を改めてご理解いただき、「公正採用選考「人権啓発推進員」の適切な配置、推進員や企業トップクラスに対して労働局、ハローワークが行う研修会への積極的な参加、適正な応募用紙※の使用等各企業内での周知により公正な採用選考が実現されるよう、上記のとおり、貴団体傘下会員企業に対し周知・啓発の御協力をお願い申し上げます。

令和7年度全国安全週間の実施に伴う協力依頼について

厚生労働省発基安 0425 第2号 令和7年4月25日

厚生労働省事務次官より、当協会会長宛に協力依頼を受領しました。以下に抜粋を記します。

労働災害の防止につきましては、平素から格別の御協力を賜わり深く感謝申し上げます。

厚生労働省におきましては、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため、毎年、全国安全週間を主唱しております。

本年も別添の「令和7年度全国安全週間実施要綱」に基づき、7月1日から7月7日までを安全週間、6月1日から6月30日までを準備期間として、

「多様な仲間と 築く安全 未来の職場」

をスローガンとし、全国一斉に積極的な活動を行うこととしました。

つきましては、この週間の趣旨を御理解いただき、関係機関及び傘下の団体等に対する周知等格段の御協力を賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。

令和7年度全国安全週間実施要綱

趣旨

全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で98回目を迎える。

この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきた。この努力により労働災害は長期的には減少しているところであるが、令和6年の労働災害については、死亡災害は集計開始以降最少となった前年を下回る見込みであるものの、休業4日以上死傷災害は前年同期よりも増加しており、平成21年以降、死傷者数が増加に転じてから続く増加傾向に歯止めがかからない状況となっている。

特に、高年齢労働者の増加等を背景として、転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起因する死傷災害が増加し続けており、また、死亡災害については、墜落・転落などによる災害が依然として後を絶たない状況にある。

また、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全に働くことができる職場環境を築くためには、令和5年3月に策定された第14次労働災害防止計画に基づく施策を着実に推進することが必要であり、計画年次3年目となる令和7年度においても、引き続き労使一丸となった取組が求められる。

以上を踏まえ、更なる労働災害の減少を図る観点から、令和7年度の全国安全週間は、以下のスローガンの下で取り組む。

経済構造実態調査の事前周知について（依頼）

総統経第23号20250304 統第1号令7年3月28日

総務大臣、経済産業大臣より、当協会会長宛に依頼を受領しました。以下に抜粋を記します。

日頃より政府が実施する各種統計調査に御理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

総務省・経済産業省では、我が国の全ての産業における企業・事業所や団体を対象とした「経済構造実態調査」を2025年6月に実施します。

「経済構造実態調査」は、全ての産業における付加価値等の構造とその変化を明らかにする基幹統計調査（統計法（平成19年法律第53号）に基づいた報告義務のある調査）であり、その調査結果は、国民経済計算（年次推計）の精度向上への寄与のほか、より正確な景気判断や効果的な行政施策の立案、実施のための基礎資料、企業経営の参考資料などに広く利活用されています。

「経済構造実態調査」のより円滑な実施に向け、その趣旨・必要性について貴団体に属する企業等の皆様へ広く周知いただきたく、統計法第30条第1項に基づき、別紙について協力を依頼いたします。

関係団体短信

一般社団法人 日本オプトメカトロニクス協会セミナー案内

『「波動としての光」 入門』 技術講座

波動光学を学ぶとき、いくつかのハードルが存在する。スカラー理論に限っても回折は難しい。物質の境界や結晶内部での光の振る舞いの記述には、マクスウェルの方程式を出発点とした複雑なベクトル理論が必須となる。

本講座は、波としての光の性質の要点を、応用を意識した立場から短時間で学ぶものである。数式の記述も行うが、その結果をどのように解釈、応用するのかという観点に立った説明をしていく。

この分野を短時間に俯瞰したい、また更に詳細な内容を学ぶ足掛かりにしたい技術者には最適の講座である。

開催日：2025年8月27日（水）10:00～16:30

会場：ハイブリッド形式（対面+オンライン）での開催となります。

- ・機械振興会館 別館4階（一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会 研修室）
- ・オンライン（Web会議ツールは Microsoft Teams です。）

講師：宮前 博 氏（チームオプト株式会社 光学技術コンサルタント）

講義内容

- 1章. 波としての光
- 2章. 干渉入門
- 3章. 入門
- 4章. 偏光入門
- 5章. 光波の伝搬
- 6章. 結晶と偏光素子

「光学実験入門」 技術講座

幾何学などで、物体と像との関係を調べたり、できた像の大きさなどを求めたりしますが、本講座では実際に凸レンズや凹レンズを用いて光学ベンチ上に組み上げ、その動向が計算結果と合致するかを確認しながら行っていきます。レンズには収差が発生することは避けられませんが、球面収差や軸上の色収差を実験でその量を計測して、同時に収差量を計算した結果と比較して理解を深めます。また、ルーペ、プロジェクター、レンズメータ、望遠鏡、顕微鏡、ズームレンズなどの光学系を光学ベンチ上に実際に作り各レンズの役割を実験でデータを取りながら確認していきます。

本講座では参加される方々に実際にレンズに触れ、光学系を組み上げて像を作ってもらいます。そして、その時の像の状態やレンズ間隔などを計測してデータ表に記入していただきます。同時に理論上の計算などを行い実験結果のデータと比較して、その違いなどを考察していきます。更に、レンズで像を作るためには、光軸が合致している事が必要不可欠であることなどを、実験を通じて理解を深めていただければと期待しております。

開催日：2025年8月7日（木）10時～17時30分、8月8日（金）9時～15時15分

会場：機械振興会館 別館4階 当協会研修室

講師：齋藤 晴司 氏

（元株式会社ニコン ビジネススタッフセンター人事部能力開発室 主幹）

プログラム：

<1日目>

1. ピンホールカメラの実験
2. レンズの焦点距離の計測実験
3. レンズによる結像実験
4. レンズの収差測定の実験
5. ルーペの実験

<2日目>

6. スライドプロジェクターの実験
7. レンズメータの実験
8. 望遠鏡の実験
9. 顕微鏡の実験
10. 組合せレンズの実験

「LED と半導体レーザーの基礎と応用」技術講座

LED や半導体レーザーは、今では光ディスク装置、光通信、表示装置、照明、各種センサーなど、我々の身の周りの様々な応用分野で使われています。このような発光デバイスの動作原理には、光学、電磁気学、熱力学、固体物性、量子力学などが関わっています。そのため全体を理解するのは時間がかかり難しそうに見えますが、基礎を学んでおくことは重要で、今後いろいろな場面で必要になってくると考えられます。

本講座は、LED と半導体レーザーについて、その動作原理を理解し、いろいろな応用においてどのような使われ方をしているかを学ぶことによって、発光デバイスの基礎と応用を習得することを目的としています。光学が関わる領域を中心としますが、半導体、量子力学も避けては通れないため、必要な部分についてわかりやすく解説します。LED や半導体レーザーの応用分野に関わる技術者、研究者に役立つ内容です。

開催日：2025年8月1日（水）10:00～16:30

会場：今年度はハイブリッド方式（オンライン+対面式）での開催となります

※オンライン（Microsoft Teams 利用）

※対面式 当協会研修室（東京都港区芝公園 3-5-22）

講師：波多腰 玄一 氏（元株式会社東芝 研究開発センター）

プログラム：

1. 半導体における発光の基礎
2. 発光ダイオード（LED）の基礎と応用
3. 半導体レーザーの基礎と応用

2025年1月生産・出荷累計統計

	生産		受入 数量	出荷			月末在庫 数量
	数量	金額 (百万円)		販売		その他 数量	
			数量	金額 (百万円)	数量		金額 (百万円)
dejitar	165,490 (1.08)	9,606 (1.09)	265,385 (1.02)	147,048 (1.31)	14,311 (1.36)	264,643 (1.03)	276,375 (0.92)
カメラ	5,896 (1.27)	7,524 (1.22)	5,036 (1.15)	4,968 (0.81)	7,218 (0.88)	5,336 (1.23)	12,762 (0.70)
交換レンズ	139,985 (1.15)	9,377 (1.11)	311,923 (1.37)	232,555 (1.06)	15,164 (1.05)	185,584 (1.58)	1,095,852 (1.00)
光学・精密測定機	23,155 (1.62)	6,699 (1.59)	—	12,941 (0.60)	4,240 (0.91)	—	99,341 (0.81)
光分析機器	13,307 (1.07)	29,961 (1.18)	—	13,170 (1.06)	28,499 (1.15)	—	25,207 (1.63)
測 量 機	3,064 (1.24)	716 (1.19)	—	7,098 (2.07)	1,295 (1.41)	—	10,321 (0.66)
合 計	—	63,883 (1.19)	—	—	70,727 (1.11)	—	—

() 内は、前年比

2025年2月生産・出荷累計統計

	生産		受入 数量	出荷			月末在庫 数量
	数量	金額 (百万円)		販売		その他 数量	
			数量	金額 (百万円)	数量		金額 (百万円)
デジタルカメラ	151,202 (0.75)	7,365 (0.68)	251,762 (0.76)	175,369 (1.06)	16,447 (1.11)	256,332 (0.79)	247,638 (0.72)
カメラ	6,615 (1.87)	8,207 (1.76)	5,380 (2.46)	8,198 (0.92)	11,339 (0.97)	5,605 (2.08)	10,954 (0.89)
交換レンズ	139,985 (1.10)	9,377 (1.07)	311,923 (0.97)	232,555 (1.13)	15,164 (1.12)	185,584 (0.96)	1,095,852 (0.95)
光学・精密測定機	17,839 (1.09)	5,857 (0.97)	—	27,090 (1.15)	6,388 (1.04)	—	90,096 (0.74)
光分析機器	13,381 (0.87)	31,388 (1.01)	—	13,779 (1.08)	29,936 (0.99)	—	24,578 (1.35)
測 量 機	2,350 (1.16)	610 (1.23)	—	7,042 (1.00)	1,140 (0.87)	—	10,366 (0.78)
合 計	—	62,804 (1.02)	—	—	80,414 (1.04)	—	—

() 内は、前年比

2025年3月生産・出荷累計統計

	生産		受入 数量	出荷			月末在庫 数量
	数量	金額 (百万円)		販売		その他 数量	
			数量	金額 (百万円)	数量		金額 (百万円)
デジタルカメラ	208,335 (1.05)	13,040 (1.17)	327,014 (1.02)	194,056 (1.23)	14,375 (1.00)	325,074 (1.02)	263,857 (0.68)
カメラ	7,637 (2.36)	10,373 (2.24)	6,489 (1.54)	8,455 (1.11)	12,511 (1.10)	6,477 (2.80)	10,148 (1.03)
交換レンズ	161,442 (1.13)	10,481 (1.04)	388,102 (1.36)	289,665 (1.21)	18,847 (1.15)	236,231 (1.38)	1,099,266 (0.94)
光学・精密測定機	17,839 (1.09)	5,857 (0.87)	—	27,090 (1.09)	6,388 (0.72)	—	90,096 (0.75)
光分析機器	15,858 (0.97)	49,436 (1.54)	—	17,629 (1.29)	52,721 (1.48)	—	21,341 (1.01)
測 量 機	3,145 (1.17)	838 (1.64)	—	13,906 (1.17)	2,247 (1.48)	—	5,424 (0.51)
合 計	—	90,025 (1.38)	—	—	107,089 (1.21)	—	—

() 内は、前年比

注) 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

- (イ) 他企業から購入したもの(輸入を含む)
- (ロ) 同一企業内の他工場から受入れたもの
- (ハ) 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの
- (ニ) 返品(戻入れ)されたもの

令和7年5月30日発行

日本光学工業協会

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 204 号室

電話・ファックス：03-3431-7073

<https://www.e-joia.jp> e-mail: joia.office@e-joia.jp

発行人 牛田 一雄

編集 上田 壮一 (事務局)